

大見研究室 和文 論文リスト

1986 年

- 7-1(P) 大見忠弘、田中和光、「超LSI用超純水装置」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.2、超純水・高純度薬品供給系、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.31-57、1986年3月。
- 8-1(P) 三島博之、大見忠弘、「ウェハ洗浄・乾燥技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.2、超純水・高純度薬品供給系、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.397-419、1986年3月。
- 9(P) 大見忠弘、「LSIの進展とそれを支える周辺技術」、化学技術週間特別講演会、(山形県工業技術センター)、1986年4月。
- 10(P) 大見忠弘、「超高真空装置の設計と実際」、第10回イオン工学シンポジウム、イオン源とイオンを基礎とした応用技術(イオン工学懇談会)、pp.709-720、1986年6月。
- 11(P) 菅野洋一、大見忠弘、「超高性能配管部品」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.3、トータルクリーンシステム、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.225-258、1986年7月。
- 12(P) 増田清隆、柴田直、大見忠弘、「クリーンルーム用無塵紙からの発塵の評価」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウム No.3、トータルクリーンシステム、プロシーディング、(リアライズ社)、pp.335-347、1986年7月。
- 13(P) 大見忠弘、「LSI基盤技術の現状と将来方向」、第2回東北地域IC関連産業振興セミナー、(仙台通商産業局)、1986年7月。
- 14(P) 大見忠弘、「半導体プロセスにおけるクリーン化とは」、東北大学大学教育開放講座、(東北大学教育学部附属大学教育開放センター)、1986年7月。
- 15(P) 大見忠弘、「電子デバイス高速化高出力化の物理と課題」、基幹技術研修講習会、(日本電気技術研修所)、1986年7月。
- 16(M) 大見忠弘、「半導体材料ガス及びガス系のスーパークリーンテクノロジー」、ULSI 7月号(サイエンスフォーラム)、pp.14-21、1986年7月。
- 17(P) 清田哲司、桑原英司、大見忠弘、柴田直、「イオンエネルギーを精密制御したRFバイアススパッタ」、電子通信学会技術研究報告、(半導体トランジスタ研究専門委員会)、論文番号 SSD86-55、1986年8月。
- 18(P) 三島博之、木幡直人、大見忠弘、「実験用ウェハ製作のためのシリコンウェハくり抜き技術」、半導体トランジスタ研究専門委員会、((社)電子通信学会)、1986年8月。
- 19(P) 大見忠弘、森田瑞穂、吉武春二、小野寺政信、熊谷浩洋、「静電チャックを用いた超高真空対応ウェハ搬送法」、半導体トランジスタ研究専門委員会、((社)電子通信学会)、1986年8月。
- 20(M) 大見忠弘、「超微細電子回路実験施設にスーパークリーンルーム棟」、青葉工業会報第30号、(東北大学工学部青葉工業会)、pp.10-11、1986年8月。
- 21(B) 大見忠弘、森川栄久、畑山忠弘、「通電加熱方式によるガス供給系のベーキング」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超高純度ガス供給システム、(リアライズ社)、pp.430-437、1986年9月。
- 22(B) 大見忠弘、黒宮茂、光地哲伸、「インラインガスフィルタからの脱ガス」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超高純度ガス供給システム(リアライズ社)、pp.448-458、1986年9月。
- 23(M) 大見忠弘、三島博之、水庭哲夫、「Materials Testing and Quality Control of High-Purity Chemicals, Gases and Water」 JSI Reports, vol.2, No.3(サイエンスフォーラム)、pp.19-29、1986年9月。

- 24(P) 大見忠弘、「ウルトラクリーンテクノロジーを可能にするトータルクリーンシステム」、第7回VLSI FOR UM(プレスジャーナル社)、1986年9月。
- 25(M) 大見忠弘、御子柴宣夫、「クリーンルームの思想」、日経産業新聞(日本経済新聞社)、1986年9月1日。
- 26(M) 大見忠弘、「借り物、寄せ集めでないクリーン・ルームを—半導体固有の基盤技術開発を目指せ—」、日経マイクロデバイス 1986年9月号、No.15、(日経マグロウヒル社)、pp.13、1986年9月。
- 27(M) 大見忠弘、福田宗治、「配管系から防塵衣まで根本から見直し塵埃を追放したクリーンルーム」、日経マイクロデバイス 1986年9月号、No.15、(日経マグロウヒル社)、pp83-113、1986年9月。
- 28(M) 大見忠弘、「スーパークリーンルームの設計思想」、日経マイクロデバイス9月号(日経マグロウヒル社)、1986年9月。
- 29(P) 大見忠弘、「Future in VLSI」、第5回目伯化学技術シンポジウム、1986年10月。
- 30(P) 大見忠弘、「LSI周辺技術」、第28回新材料開発システム文化会講演会、((社)システム総合研究所)、1986年10月。
- 31(M) 大見忠弘、(尾崎正直)、「極限LSIは在来技術の延長ではだめだ」、週刊朝日、Mita化学技術対談、(朝日新聞社)、pp.138-141、1986年10月。
- 32(P) 大見忠弘、「薄膜の性質とその応用」、昭和61年度新技術研修講演会(宮城県高度技術振興財団)、1986年11月。
- 33(P) 大見忠弘、「LSIプロセス技術の将来・・・ウルトラクリーンテクノロジー・・・」、長崎総合科学大学公開講演会、1986年11月。
- 34(M) 大見忠弘、御子柴宣夫、坪内和夫、「スーパークリーンルームへの道—メガビット時代への対応図る—」、日経マイクロデバイス 11月号、No.17、(日経マグロウヒル社)、pp.176-198、1986年11月。
- 7-2(B) 大見忠弘、田中和光、「超LSI用超純水装置」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超純水・高純度薬品供給システム、(リアライズ社)、pp.41-55、1986年12月。
- 35(B) 大見忠弘、「超純水装置管路性能評価」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超純水・高純度薬品供給システム、(リアライズ社)、pp.57-60、1986年12月。
- 8-2(B) 三島博之、大見忠弘、「ウェハ洗浄・乾燥技術」、大見、新田監修、半導体基盤技術研究会編、超純水・高純度薬品供給システム、(リアライズ社)、pp.305-318、1986年12月。